

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成28年8月12日(2016.8.12)

【公表番号】特表2015-522687(P2015-522687A)

【公表日】平成27年8月6日(2015.8.6)

【年通号数】公開・登録公報2015-050

【出願番号】特願2015-520342(P2015-520342)

【国際特許分類】

C 09 J 5/02 (2006.01)

C 09 J 11/06 (2006.01)

C 09 J 4/02 (2006.01)

【F I】

C 09 J 5/02

C 09 J 11/06

C 09 J 4/02

【手続補正書】

【提出日】平成28年6月20日(2016.6.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

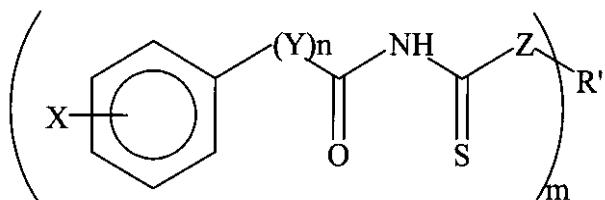
【特許請求の範囲】

【請求項1】

硬化性組成物から反応生成物を調製する方法であつて：

構造IまたはIAの範囲内の化合物を所望の基体表面に塗布するステップ、

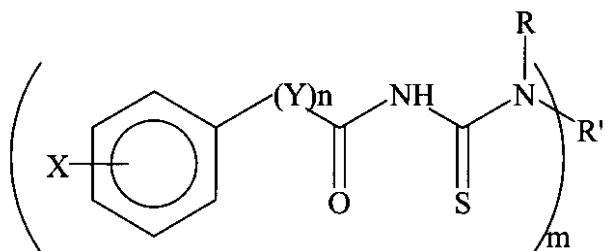
【化1】



I

(式中、Zは、OまたはN-Rであり、RおよびR'は、独立に、水素、アルキル、アルケニル、アリール、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシルまたはスルホナトから選択され、あるいはRおよびR'は、一緒にになって環状炭素またはヘテロ原子含有環を形成し、あるいはR'は、式中のフェニル環に附加している直接結合であり；Xは、ハロゲン、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルコキシ、アミノ、アルキレン-もしくはアルケニレン-エーテル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシル、ニトロソ、スルホネート、ヒドロキシルまたはハロアルキルであり；Yは、-SO₂NH-、-CONH-、-NH-、および-PO(NHC(=O)NH₂)_nH-であり；nは、0または1であり、mは、1または2である。)

【化2】



I A

(式中、RおよびR'は、独立に、水素、アルキル、アルケニル、アリール、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシルまたはスルホナトから選択され、あるいはRおよびR'は、一緒になって環状炭素またはヘテロ原子含有環を形成し、あるいはR'は、式中のフェニル環に付加している直接結合であり；Xは、ハロゲン、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルコキシ、アミノ、アルキレン-もしくはアルケニレン-エーテル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシル、ニトロソ、スルホネート、ヒドロキシルまたはハロアルキルであり；Yは、-SO₂NH-、-CONH-、-NH-、および-PO(NHC(=O)HCSNH₂)NH-であり；nは、0または1であり、mは、1または2である。)

(メタ)アクリレート成分および酸化剤を含む組成物をその所望の基体表面に塗布するステップ、

第2の表面とその基体表面を組み合わせて組立品を形成するステップ、および前記組立品を、前記組成物を硬化させるのに十分な時間、適切な条件に曝すステップを含む方法。

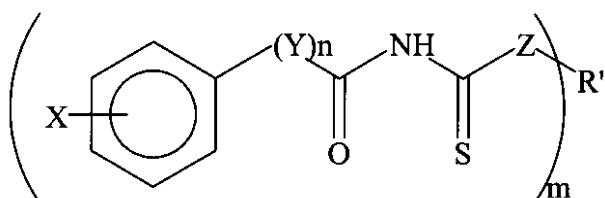
【請求項2】

硬化性組成物から反応生成物を調製する方法であって：

(メタ)アクリレート成分および酸化剤を含む組成物を所望の基体表面に塗布するステップ、

構造IまたはIAの範囲内の化合物をその所望の基体表面に塗布するステップ、

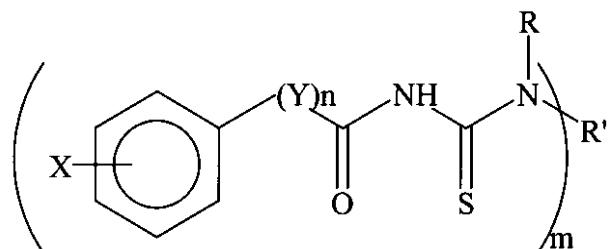
【化3】



I

(式中、Zは、OまたはN-Rであり、RおよびR'は、独立に、水素、アルキル、アルケニル、アリール、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシルまたはスルホナトから選択され、あるいはRおよびR'は、一緒になって環状炭素またはヘテロ原子含有環を形成し、あるいはR'は、式中のフェニル環に付加している直接結合であり；Xは、ハロゲン、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルコキシ、アミノ、アルキレン-もしくはアルケニレン-エーテル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシル、ニトロソ、スルホネート、ヒドロキシルまたはハロアルキルであり；Yは、-SO₂NH-、-CONH-、-NH-、および-PO(NHC(=O)HCSNH₂)NH-であり；nは、0または1であり、mは、1または2である。)

【化4】



I A

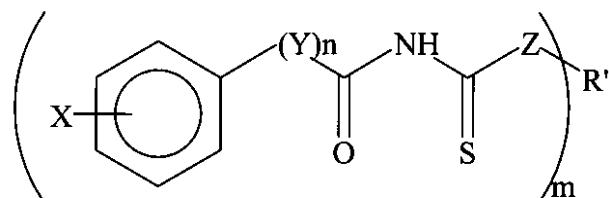
(式中、RおよびR'は、独立に、水素、アルキル、アルケニル、アリール、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシルまたはスルホナトから選択され、あるいはRおよびR'は、一緒になって環状炭素またはヘテロ原子含有環を形成し、あるいはR'は、式中のフェニル環に付加している直接結合であり；Xは、ハロゲン、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルコキシ、アミノ、アルキレン-もしくはアルケニレン-エーテル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシル、ニトロソ、スルホネート、ヒドロキシルまたはハロアルキルであり；Yは、-SO₂NH-、-CONH-、-NH-、および-PO(NHC(=O)HCSNH₂)NH-であり；nは、0または1であり、mは、1または2である。)

第2の表面とその基体表面を組み合わせて組立品を形成するステップ、および前記組立品を、前記組成物を硬化させるのに十分な時間、適切な条件に曝すステップを含む方法。

【請求項3】

硬化性組成物から反応生成物を調製する方法であって：
酸化剤を所望の基体表面に塗布するステップ、
(メタ)アクリレート成分および構造IまたはIAの範囲内の化合物を含む組成物をその所望の基体表面に塗布するステップ、

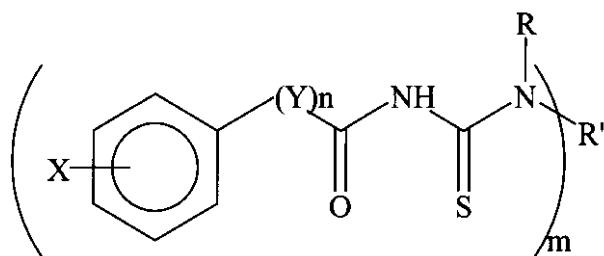
【化5】



I

(式中、Zは、OまたはN-Rであり、RおよびR'は、独立に、水素、アルキル、アルケニル、アリール、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシルまたはスルホナトから選択され、あるいはRおよびR'は、一緒になって環状炭素またはヘテロ原子含有環を形成し、あるいはR'は、式中のフェニル環に付加している直接結合であり；Xは、ハロゲン、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルコキシ、アミノ、アルキレン-もしくはアルケニレン-エーテル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシル、ニトロソ、スルホネート、ヒドロキシルまたはハロアルキルであり；Yは、-SO₂NH-、-CONH-、-NH-、および-PO(NHC(=O)HCSNH₂)NH-であり；nは、0または1であり、mは、1または2である。)

【化6】



I A

(式中、RおよびR'は、独立に、水素、アルキル、アルケニル、アリール、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシルまたはスルホナトから選択され、あるいはRおよびR'は、一緒になって環状炭素またはヘテロ原子含有環を形成し、あるいはR'は、式中のフェニル環に付加している直接結合であり；Xは、ハロゲン、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルコキシ、アミノ、アルキレン-もしくはアルケニレン-エーテル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシル、ニトロソ、スルホネート、ヒドロキシルまたはハロアルキルであり；Yは、-SO₂NH-、-CONH-、-NH-、および-PO(NHC(=O)HCSNH₂)NH-であり；nは、0または1であり、mは、1または2である。)

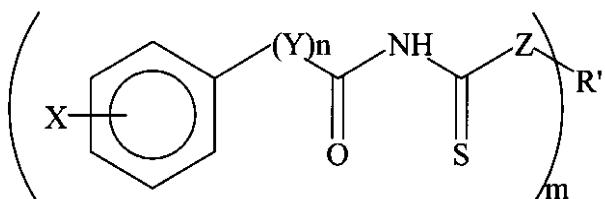
第2の表面とその基体表面を組み合わせて組立品を形成するステップ、および前記組立品を、前記組成物を硬化させるのに十分な時間、適切な条件に曝すステップを含む方法。

【請求項4】

硬化性組成物から反応生成物を調製する方法であつて：

(メタ)アクリレート成分および構造IまたはIAの範囲内の化合物を含む組成物を所望の基体表面に塗布するステップ、

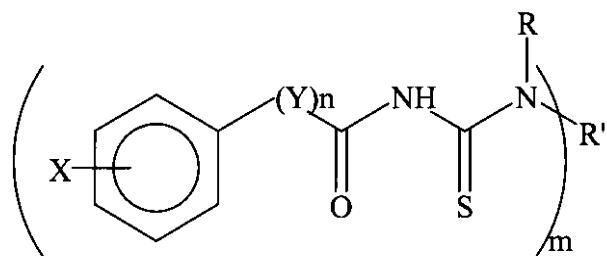
【化7】



I

(式中、Zは、OまたはN-Rであり、RおよびR'は、独立に、水素、アルキル、アルケニル、アリール、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシルまたはスルホナトから選択され、あるいはRおよびR'は、一緒になって環状炭素またはヘテロ原子含有環を形成し、あるいはR'は、式中のフェニル環に付加している直接結合であり；Xは、ハロゲン、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルコキシ、アミノ、アルキレン-もしくはアルケニレン-エーテル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシル、ニトロソ、スルホネート、ヒドロキシルまたはハロアルキルであり；Yは、-SO₂NH-、-CONH-、-NH-、および-PO(NHC(=O)HCSNH₂)NH-であり；nは、0または1であり、mは、1または2である。)

【化8】



IA

(式中、RおよびR'は、独立に、水素、アルキル、アルケニル、アリール、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシルまたはスルホナトから選択され、あるいはRおよびR'は、一緒になって環状炭素またはヘテロ原子含有環を形成し、あるいはR'は、式中のフェニル環に付加している直接結合であり；Xは、ハロゲン、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルコキシ、アミノ、アルキレン-もしくはアルケニレン-エーテル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシル、ニトロソ、スルホネート、ヒドロキシルまたはハロアルキルであり；Yは、-SO₂NH-、-CONH-、および-PO(NHC(=O)HCSNH₂)NH-であり；nは、0または1であり、mは、1または2である。)

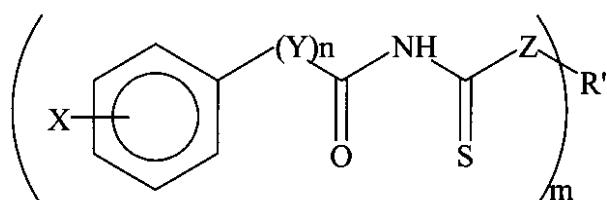
酸化剤をその所望の基体表面に塗布するステップ、

第2の表面とその基体表面を組み合わせて組立品を形成するステップ、および前記組立品を、前記組成物を硬化させるのに十分な時間、適切な条件に曝すステップを含む方法。

【請求項5】

構造IAまたはI Aの範囲内の硬化促進剤を含むプライマー組成物。

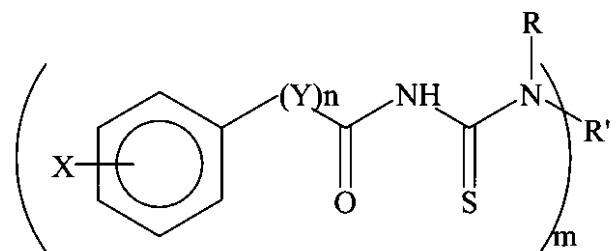
【化9】



I

(式中、Zは、OまたはN-Rであり、RおよびR'は、独立に、水素、アルキル、アルケニル、アリール、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシルまたはスルホナトから選択され、あるいはRおよびR'は、一緒になって環状炭素またはヘテロ原子含有環を形成し、あるいはR'は、式中のフェニル環に付加している直接結合であり；Xは、ハロゲン、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルコキシ、アミノ、アルキレン-もしくはアルケニレン-エーテル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシル、ニトロソ、スルホネート、ヒドロキシルまたはハロアルキルであり；Yは、-SO₂NH-、-CONH-、-NH-、および-PO(NHC(=O)HCSNH₂)NH-であり；nは、0または1であり、mは、1または2である。)

【化10】



I A

(式中、RおよびR'は、独立に、水素、アルキル、アルケニル、アリール、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシルまたはスルホナトから選択され、あるいはRおよびR'は、一緒になって環状炭素またはヘテロ原子含有環を形成し、あるいはR'は、式中のフェニル環に付加している直接結合であり；Xは、ハロゲン、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシアルケニル、アルコキシ、アミノ、アルキレン-もしくはアルケニレン-エーテル、アルキレン(メタ)アクリレート、カルボニル、カルボキシル、ニトロソ、スルホネート、ヒドロキシルまたはハロアルキルであり；Yは、-SO₂NH-、-CONH-、-NH-、および-PO(NHC(=O)HCSNH₂)NH-であり；nは、0または1であり、mは、1または2である。)